

05  
**Микролазеры с распределенными брэгговскими отражателями**  
 **$\text{Al}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{As}/\text{Al}_{0.9}\text{Ga}_{0.1}\text{As}$**

© А.В. Бабичев<sup>1</sup>, И.С. Махов<sup>2</sup>, Н.В. Крыжановская<sup>2</sup>, Ю.М. Задиранов<sup>1</sup>, Ю.А. Салий<sup>1</sup>, М.М. Кулагина<sup>1</sup>,  
Я.Н. Ковач<sup>1,3</sup>, А.А. Блохин<sup>1</sup>, М.А. Бобров<sup>1</sup>, А.П. Васильев<sup>1</sup>, С.А. Блохин<sup>1</sup>, Н.А. Малеев<sup>1</sup>,  
Л.Я. Карачинский<sup>3</sup>, И.И. Новиков<sup>3</sup>, А.Ю. Егоров<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе,  
Санкт-Петербург, Россия

<sup>2</sup> Национальный исследовательский университет „Высшая школа экономики“,  
Санкт-Петербург, Россия

<sup>3</sup> Университет ИТМО,  
Санкт-Петербург, Россия

e-mail: a.babichev@mail.ioffe.ru

Поступила в редакцию 18.09.2025 г.

В окончательной редакции 16.02.2026 г.

Принята к публикации 27.02.2026 г.

Представлены результаты по реализации генерации при повышенных температурах в лазерах с длиной волны генерации 980 nm на основе вертикального микрорезонатора с использованием непоглощающих на длине волны оптической накачки зеркал. Минимальная пороговая мощность накачки составила  $\sim 0.8$  mW и соответствовала температуре 150 К. Добротность микрорезонатора, определенная на пороге генерации, превысила 13000. Максимальная рабочая температура микролазера составила 195 К. Увеличение температуры до 195 К привело к повышению пороговой мощности до 1.7 mW.

**Ключевые слова:** микролазеры, вертикальный микрорезонатор, квантовые точки, механизм Странского–Крастанова, оптические резервуарные вычисления.

DOI: 10.61011/OS.2026.03.62773.8581-25

## Введение

Массивы спектрально-однородных лазеров на основе вертикального микрорезонатора могут быть использованы для реализации схемы фотонных резервуарных вычислений (РВ) [1–4]. Вертикально-излучающие лазеры (ВИЛ) [5,6] также могут обеспечить дифракционное связывание (ДС) лазеров в массиве и, как следствие, быть применены для реализации фотонных РВ [7–12], однако максимальное число лазеров в массиве, обеспечивающих ДС, не превышает 24 [11], что обусловлено значительным шагом расположения ВИЛ в массиве (80–100  $\mu\text{m}$  [1]). Использование лазеров на основе вертикального микрорезонатора с оптической накачкой позволяет создавать массивы плотно расположенных элементов, с шагом расположения на порядок меньше, в сравнении с ВИЛ (8–10  $\mu\text{m}$  [1,13]). Основными недостатками реализации схемы РВ на основе лазеров с вертикальным микрорезонатором являются низкие рабочие температуры и значительные пороговые мощности накачки. Максимальная температура для микролазеров с полупроводниковыми распределенными брэгговскими отражателями (РБО) на основе чередующихся четвертьволновых слоев  $\text{Al}_{0.9}\text{Ga}_{0.1}\text{As}/\text{GaAs}$ , при которой продемонстрирована лазерная генерация, составляет 130 К, а величина пороговой мощности накачки при данной температуре не превышает 1.2 mW [3]. Использование непоглощающих на длине волны накачки полупроводни-

ковых зеркал (на основе  $\text{Al}_{0.9}\text{Ga}_{0.1}\text{As}/\text{Al}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{As}$ ) позволило авторам значительно снизить порог генерации, но максимальная рабочая температура лазера составила 77 К [4], что обусловлено недостаточным усилением активных областей на основе одного слоя  $\text{InGaAs}$  КТ.

В настоящей работе представлены первые результаты по реализации генерации при повышенных температурах (до 195 К) в микролазерах с полупроводниковыми РБО на основе слоев  $\text{Al}_{0.9}\text{Ga}_{0.1}\text{As}/\text{Al}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{As}$ .

## Детали эксперимента

Гетероструктура вертикального микрорезонатора выращена методом молекулярно-пучковой эпитаксии на полуизолирующей подложке GaAs с кристаллографической ориентацией (100). В сравнении с ранее представленными результатами для конструкции микрорезонатора с непоглощающими РБО, эпитаксия которых проводилась методом газовой фазной эпитаксии из металлоорганических соединений [4], увеличено число слоев квантовых точек (КТ) с целью повышения усиления активной области и реализации генерации при повышенных температурах. Ранее в гетероструктурах вертикального микрорезонатора использовались КТ, самоорганизация которых происходила из слоя  $\text{In}_{0.33}\text{Ga}_{0.67}\text{As}$  [14] или  $\text{In}_{0.37}\text{Ga}_{0.63}\text{As}$  [4,15]. С целью реализации нулевой величины рассогласования между положением максимума в

спектре фотолюминесценции КТ и резонансной длиной волны микрорезонатора при повышенных температурах (130 К) состав КТ был изменен. Три слоя КТ, самоорганизация которых происходила по методу Странски-Крастанова [16], формировались из слоя  $In_{0.5}Ga_{0.5}As$  толщиной  $\sim 1.9$  nm. Слои КТ помещены в центр слоя GaAs, формирующего вертикальный микрорезонатор. В сравнении с результатами [3,4,15] толщина микрорезонатора (величина  $L_g$ ) с длиной  $\lambda/n$ , где  $\lambda$  — длина волны,  $n$  — показатель преломления, уменьшена до 210 nm. Нижний и верхний РБО формировались на основе четвертьволновых ( $\lambda/4n$ ) чередующихся слоев  $Al_{0.2}Ga_{0.8}As/Al_{0.9}Ga_{0.1}As$ . Детальное описание гетероструктуры и исследование ее структурного качества представлено в работе [17]. Микролазеры с диаметром  $5 \mu m$  сформированы методом сухого травления. Для формирования профиля травления в качестве маски использован „задубленный“ фоторезист. Наклон боковой стенки микролазера составил менее  $1^\circ$ .

Исследование спектров микрофотолюминесценции (микроФЛ) микролазеров при различных температурах проведено при расположении в оптическом криостате Cryostation s50 (Montana Instruments Corp.). Для оптической накачки использован полупроводниковый лазер с длиной волны накачки 808 nm, работающий в непрерывном режиме накачки. Фокусировка излучения лазера, используемого для накачки, в пятно диаметром  $1-2 \mu m$  проведена с помощью микрообъектива M Plan Apo NIR (Mitutoyo Corp.) с 100 кратным увеличением. Для регистрации спектров люминесценции использован монохроматор Shamrock 500i (Oxford Instruments Andor Ltd), оснащенный дифракционной решеткой на основе 1200 штрихов на mm, обеспечивающей спектральное разрешение 0.05 nm.

## Результаты и их обсуждение

В ходе исследований проведено измерение спектров микроФЛ при различных уровнях оптической накачки в диапазоне температур 77–195 К. Показано, линия люминесценции вблизи 980 nm (см. вставки к рис. 1) демонстрирует сверхлинейный рост интегральной интенсивности излучения с увеличением уровня оптической накачки, что наряду с заужением линии люминесценции свидетельствует о наличии генерации в исследуемых микролазерах [4]. На основе распределения Гаусса [1] проведена аппроксимация формы данной линии в спектрах люминесценции, измеренных при различных уровнях оптической накачки, и температурах (рис. 1). S-образная (в двойном логарифмическом масштабе) зависимость интегральной интенсивности излучения (выходной оптической мощности,  $P_{out}$ ) от мощности оптической накачки ( $P_{pump}$ ) может быть аппроксимирована на основе результата решения скоростных уравнений [4,18]

и описана с помощью выражения:

$$P_{pump} = \kappa \gamma q \left( b P_{out} (1 + \xi) (1 + \beta b P_{out}) / (1 + b P_{out}) - \xi \beta b P_{out} \right) / \delta \beta, \quad (1)$$

где  $\kappa$  — коэффициент, характеризующий эффективность оптической накачки КТ и учитывающий поглощение излучения в слоях верхнего РБО и микрорезонатора,  $q$  — заряд электрона,  $b$  — коэффициент, связывающий среднее число фотонов в оптической моде и выходную оптическую мощность,  $\xi$  — параметр, характеризующий число фотонов в лазерной моде при достижении порога прозрачности,  $\delta$  — эффективность преобразования поглощенной мощности в число экситонов,  $\gamma$  — обратное время жизни фотонов в микрорезонаторе и  $\beta$  — фактор, определяющий долю спонтанного излучения в лазерной моде. Величина  $\kappa(\lambda)$  может быть определена с учетом выражения [3]:

$$\kappa(\lambda) = T_{DBR}(\lambda) \left[ (1 - \exp(-\alpha_{GaAs}(\lambda, T)L_g)) + (1 - \exp(-\alpha_{WL}(\lambda, T)L_{WL})) \right], \quad (2)$$

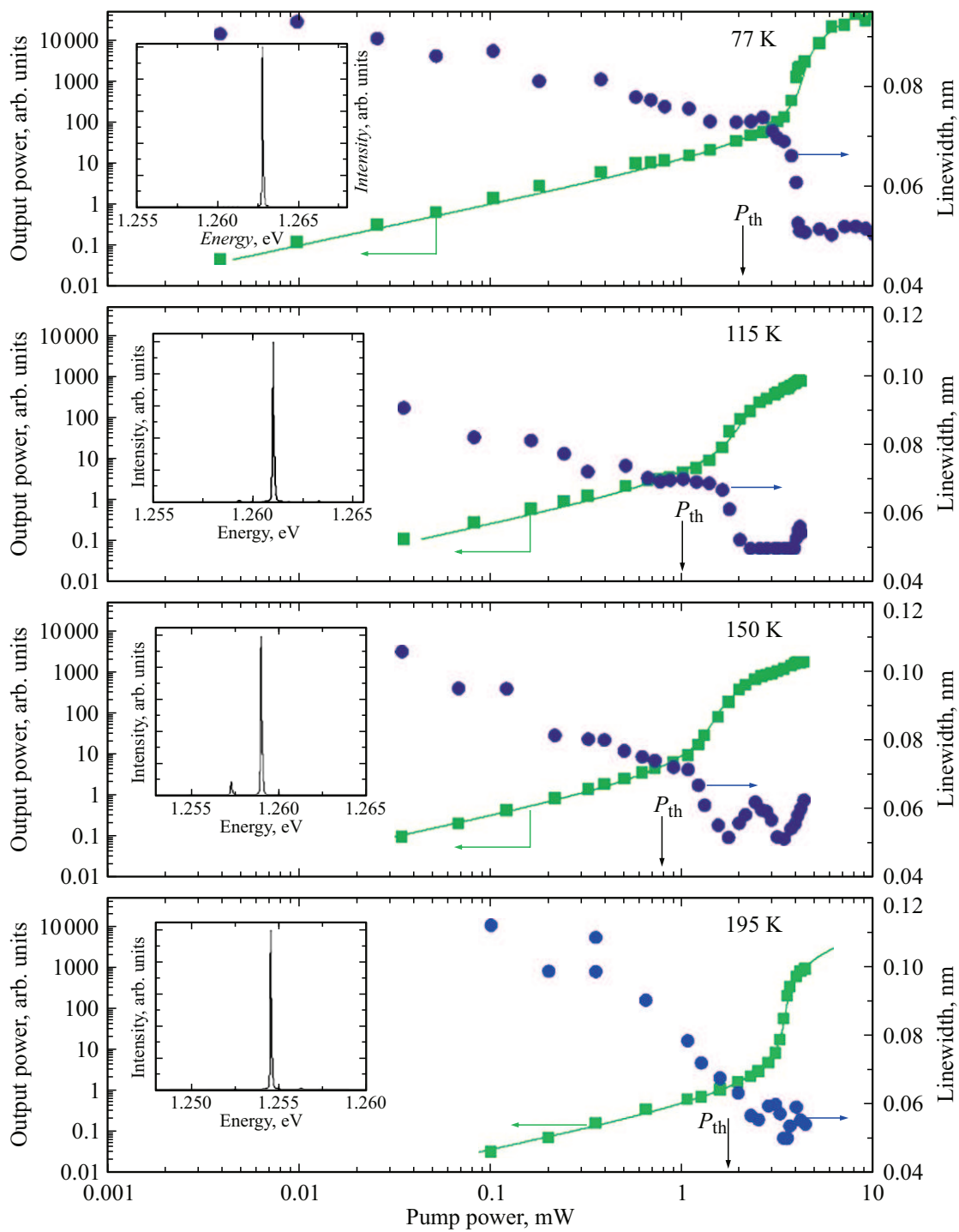
где  $T_{DBR}(\lambda)$  — коэффициент пропускания верхнего РБО на заданной длине волны,  $\alpha_{GaAs}(\lambda, T)$  — коэффициент поглощения GaAs на заданной длине волны и при фиксированной температуре  $T$ ,  $\alpha_{WL}(\lambda, T)$  — коэффициент поглощения смачивающего слоя ( $In_{0.5}Ga_{0.5}As$ ) на заданной длине волны при фиксированной температуре  $T$ . Величина  $T_{DBR}(\lambda)$  описывается с помощью выражения [3]:

$$T_{DBR}(\lambda) = (1 - R_{DBR}(\lambda)) \exp(-\alpha_{AlGaAs}(\lambda, T)L_{DBR}), \quad (3)$$

где  $R_{DBR}$  — коэффициент отражения верхнего РБО на заданной длине волны,  $\alpha_{AlGaAs}$  — коэффициент поглощения слоев AlGaAs, формирующих верхний РБО, и  $L_{DBR}$  — суммарная толщина данных слоев верхнего РБО. С учетом данных по поглощению (Al)GaAs и InGaAs, представленных в работах [3,19–22], и расчетных спектров отражения верхнего РБО (расчет методом матриц переноса при различных температурах) проведена оценка коэффициента  $\kappa$ , характеризующего эффективность накачки активной области, которая составила 13.5% при 77 К. Увеличение температуры до 195 К привело к росту эффективности накачки до 15.0%. Величина  $\gamma$  описывается на основе выражения [3]:

$$\gamma = 2\pi E/hQ, \quad (4)$$

где  $E$  — энергия кванта,  $Q$  — добротность микрорезонатора,  $h$  — постоянная Планка, выраженная в eV·s. Величина  $\delta$  определяется на основе анализа допороговых мощностных характеристик [3]. С учетом данных значений построены зависимости  $P_{out}(P_{pump})$ , представленные на рис. 1.

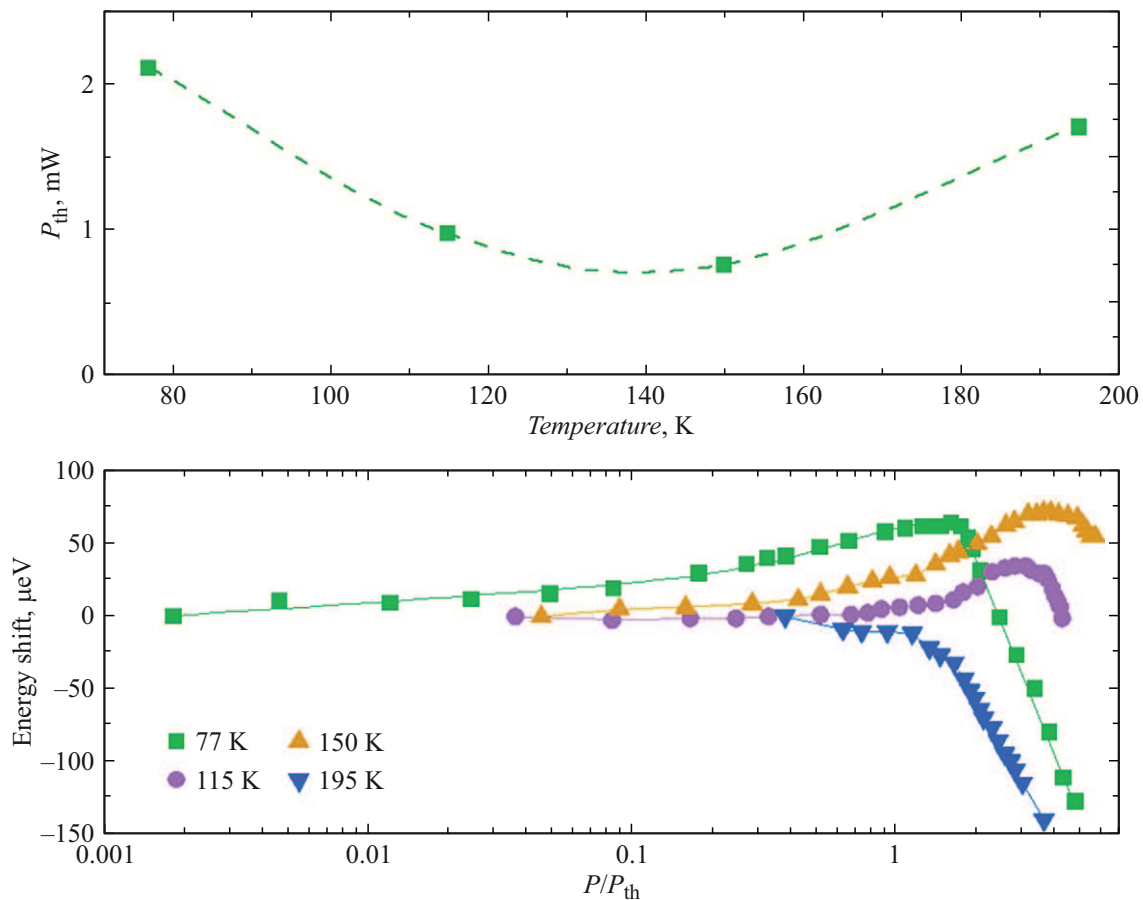


**Рис. 1.** Зависимости интегральной интенсивности излучения (левая ось  $Y$ ) и полуширины линии генерации 980 nm (правая ось  $Y$ ) от мощности накачки. Панели (сверху вниз) — при температурах 77 К, 115 К, 150 К и 195 К. Вставки соответствуют спектрам генерации при фиксированной мощности оптической накачки 4.3 mW.

Пороговое значение мощности накачки  $P_{th}$  может быть определено при условии, что среднее число фотонов на пороге генерации равно единице ( $bP_{out} = 1$ ) и описывается на основе выражения [18]:

$$P_{th} = \kappa \nu q [1 + \beta + \xi(1 - \beta)] / 2\delta\beta. \quad (5)$$

Зависимость  $P_{th}(T)$  приведена на рис. 2, верхняя панель. Показано, минимум температурной зависимости порога генерации соотносится с температурой, соответствующей нулевому рассогласованию между положением максимума спектра фотолуминесценции КТ и резонансной длиной волны микрорезонатора. Наимень-



**Рис. 2.** Верхняя панель: зависимость пороговой мощности оптической накачки от температуры микролазера. Нижняя панель: зависимости сдвига положения линии генерации (энергии кванта) от уровня оптической накачки, соответствующие температуре 77 К, 115 К, 150 К и 195 К.

шее экспериментальное значение пороговой мощности накачки составляет  $\sim 760 \mu W$  и соответствует температуре 150 К. Пороговая поглощенная мощность, определяемая как произведение  $\kappa(\lambda)$  и  $P_{th}$ , приведенная к слою КТ, составила  $\sim 40 \mu W$ , что соотносится с ранее представленными результатами при более низкой температуре ( $P_{th} \sim 40 \mu W$  для  $5.4 \mu m$  микролазера при 77 К [4]). Максимальная величина  $\beta$ -фактора соответствовала температуре минимума порога накачки (150 К) и равнялась  $(0.7 \pm 0.2) \%$ . Данное значение сопоставимо с ранее обсуждаемыми для высокодобротных микрорезонаторов ( $\beta = 1.0 \pm 0.3 \%$  для  $5.4 \mu m$  микролазера при 77 К [4]). Величина добротности микрорезонатора, определенная на пороге генерации ( $Q_{thr}$ ), составила 13300. Большие значения  $Q_{thr}$  (15000 для  $5.4 \mu m$  микролазера [4]) обсуждались ранее, однако данные результаты соответствуют температуре 77 К и, как следствие, меньшему разогреву лазера.

Максимальная температура, при которой наблюдался переход к лазерной генерации, подтвержденный S-образной мощностной характеристикой, составила 195 К. Значение пороговой мощности при данной температуре ( $\sim 1.7 mW$ ) меньше аналогичной величины

( $2.6 mW$ ) для планарных микролазеров с генерацией на дефектной моде [14]. Для микролазеров с РБО на основе  $Al_{0.2}Ga_{0.8}As/Al_{0.9}Ga_{0.1}As$ , эпитаксия которых проводилась методом газовой фазной эпитаксии, максимальная температура, при которой наблюдалась генерация, составила 200 К, а порог генерации составил  $1.9 mW$  [23].

Ранее было показано [4,14,24], применение РБО на основе  $GaAs/Al_{0.9}Ga_{0.1}As$ , поглощающих на длине волны накачки (в слоях  $GaAs$ , формирующих РБО), приводит к дополнительному разогреву микролазера, что выражается в длинноволновом сдвиге длины волны генерации с ростом уровня накачки и уширении линии генерации [4]. В свою очередь, использование непоглощающих на длине волны накачки зеркал (переход к использованию  $Al_{0.2}Ga_{0.8}As$  взамен  $GaAs$ ) позволяет минимизировать тепловые эффекты. Как результат, уширения линии генерации и существенного сдвига ее длины волны не продемонстрировано как для случая генерации на вертикальной моде [4,14], так и на моде шепчущей галереи [15,25]. В исследованных микролазерах также не наблюдается существенного уширения линии генерации с ростом уровня накачки (рис. 1). Положение линии генерации в спектрах люминесценции микролазера, из-

меренных при различных температурах, представлено на рис. 2, нижняя панель. При температуре 77 К, в допороговом режиме наблюдается сдвиг линии ФЛ в коротковолновую область спектра ( $\sim 60 \mu\text{eV}$ ) с последующим превалярованием тепловых эффектов вследствие высоких пороговых значений мощности накачки при данной температуре, что дает длинноволновый сдвиг положения линии на  $16 \mu\text{eV}$  (до  $+44 \mu\text{eV}$ ) при двухкратном превышении пороговой мощности накачки. Повышение температуры до 115 К приводит к более выраженному коротковолновому сдвигу линии генерации ( $35 \mu\text{eV}$ ), что соответствует трехкратному превышению порога накачки, с последующим превалярованием тепловых эффектов. При температуре, соответствующей минимуму пороговой мощности накачки (150 К), коротковолновый сдвиг положения линии генерации составляет  $70 \mu\text{eV}$ , что обусловлено превалярованием плазменных эффектов [4], вызванных увеличением числа инжектируемых носителей над тепловыми эффектами, вследствие разогрева образца. Увеличение температуры до 195 К приводит к длинноволновому сдвигу линии генерации в допороговом режиме, что свидетельствует о преваляровании разогрева образца во всем диапазоне уровней накачки.

## Заключение

В работе представлены результаты по реализации генерации при повышенных температурах в микролазерах с полупроводниковыми РБО. Использование непоглощающих на длине волны накачки зеркал позволило повысить эффективность оптической накачки в 5 раз, которая составила 15% при 195 К. Минимальная пороговая мощность накачки ( $\sim 40 \mu\text{W}$  при 150 К) соответствует температуре нулевого рассогласования между положением люминесценции КТ и резонансной длины волны микрорезонатора и соотносится с ранее представленными результатами, полученными при более низких температурах ( $P_{\text{th}} \sim 40 \mu\text{W}$  при 77 К [4]). Максимальная оценочная величина  $\beta$ -фактора составила  $(0.7 \pm 0.2)\%$ . Использование непоглощающих на длине волны накачки зеркал позволило повысить температурную стабильность лазера и реализовать генерацию в микролазерах с вертикальным микрорезонатором при 195 К с пороговой мощностью накачки менее  $2 \text{ mW}$ . Аналогичные выходные характеристики продемонстрированы для микролазеров, выращенных методом газовой эпитаксии [23]. Данные результаты открывают возможность реализации схемы резервуарных вычислений на основе микролазеров с оптической накачкой, при температуре более чем в 2 раза превышающей ранее обсуждаемую [1].

## Финансирование работы

Работа А.В. Бабичева, Я.Н. Ковача, А.А. Блохина, А.П. Васильева и С.А. Блохина выполнена за счет

средств гранта Российского научного фонда № 22-19-00221-П, <https://rscf.ru/project/22-19-00221/> в части эпитаксии гетероструктуры, формирования микролазеров, измерения спектров генерации. И.С. Махов, Н.В. Крыжановская благодарят за финансовую поддержку Программу фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в части исследования спектров фотолюминесценции со скола гетероструктуры микрорезонатора (под углом  $90^\circ$ ).

## Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

## Список литературы

- [1] T. Heuser, J. Grose, S. Holzinger, M.M. Sommer, S. Reitzenstein. IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., **26** (1), 1 (2020). DOI: 10.1109/JSTQE.2019.2925968
- [2] T. Heuser, J. Große, A. Kaganskiy, D. Brunner, S. Reitzenstein. APL Photonics, **3** (11), 116103 (2018). DOI: 10.1063/1.5050669
- [3] L. Andreoli, X. Porte, T. Heuser, J. Große, B. Moeglen-Paget, L. Furfaro, S. Reitzenstein, D. Brunner. Opt. Express, **29** (6), 9084 (2021). DOI: 10.1364/OE.417063
- [4] C.-W. Shih, I. Limame, S. Krüger, C.C. Palekar, A. Koulas-Simos, D. Brunner, S. Reitzenstein. Appl. Phys. Lett., **122** (15), 151111 (2023). DOI: 10.1063/5.0143236
- [5] S.A. Blokhin, A.V. Babichev, A.G. Gladyshev, I.I. Novikov, A.A. Blokhin, M.A. Bobrov, N.A. Maleev, V.V. Andryushkin, D.V. Denisov, K.O. Voropaev, V.M. Ustinov, V.E. Bougrov, A.Y. Egorov, L.Y. Karachinsky. Opt. Eng., **61** (9), 096109 (2022). DOI: 10.1117/1.OE.61.9.096109
- [6] A. Babichev, S. Blokhin, A. Gladyshev, L. Karachinsky, I. Novikov, A. Blokhin, M. Bobrov, Y. Kovach, A. Kuzmenkov, V. Nevedomsky, N. Maleev, E. Kolodeznyi, K. Voropaev, A. Vasilyev, V. Ustinov, A. Egorov, S. Han, S.-C. Tian, D. Bimberg. Photonics, **10** (6), 660 (2023). DOI: 10.3390/photonics10060660
- [7] A. Skalli, J. Robertson, D. Owen-Newns, M. Hejda, X. Porte, S. Reitzenstein, A. Hurtado, D. Brunner. Opt. Mater. Express, **12** (6), 2395 (2022). DOI: 10.1364/OME.450926
- [8] Z. Chen, A. Sludds, R. Davis, I. Christen, L. Bernstein, L. Ateshian, T. Heuser, N. Heermeier, J.A. Lott, S. Reitzenstein, R. Hamerly, D. Englund. Nat. Photon., **17**, 723 (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01233-w
- [9] T. Heuser, M. Pflüger, I. Fischer, J.A. Lott, D. Brunner, S. Reitzenstein. J. Phys. Photonics, **2** (4), 044002 (2020). DOI: 10.1088/2515-7647/aba671
- [10] A. Skalli, X. Porte, N. Haghighi, S. Reitzenstein, J.A. Lott, D. Brunner. Opt. Mater. Express, **12** (7), 2793 (2022). DOI: 10.1364/OME.451524
- [11] M. Pflüger, D. Brunner, T. Heuser, J.A. Lott, S. Reitzenstein, I. Fischer. Opt. Lett., **49** (9), 2285 (2024). DOI: 10.1364/ol.518946
- [12] A. Skalli, M. Goldmann, N. Haghighi, S. Reitzenstein, J.A. Lott, D. Brunner. Commun. Phys., **8** (1), 68 (2025). DOI: 10.1038/s42005-025-01972-y
- [13] A. Babichev, I. Makhov, N. Kryzhanovskaya, A. Blokhin, Y. Zadiranov, Y. Saliy, M. Kulagina, M. Bobrov, A. Vasil'ev, S. Blokhin, N. Maleev, M. Tchernycheva, L. Karachinsky,

- I. Novikov, A. Egorov. IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., **31** (5), 1900208 (2024). DOI: 10.1109/JSTQE.2024.3494245
- [14] K. Gaur, C.-W. Shih, I. Limame, A. Koulas-Simos, N. Heermeier, C.C. Palekar, S. Tripathi, S. Rodt, S. Reitzenstein. Appl. Phys. Lett., **124** (4), 041104 (2024). DOI: 10.1063/5.0177393
- [15] I. Limame, C.-W. Shih, A. Koulas-Simos, J. Pietsch, L.J. Roche, M. Plattner, A. Koltchanov, S. Rodt, S. Reitzenstein. Opt. Express, **32** (18), 31819 (2024). DOI: 10.1364/OE.529679
- [16] А.В. Бабичев, С.Д. Комаров, Ю.С. Ткач, В.Н. Неведомский, С.А. Блохин, Н.В. Крыжановская, А.Г. Гладышев, Л.Я. Карачинский, И.И. Новиков. ФТП, **57** (1), 63 (2023). DOI: 10.21883/ftp.2023.01.54932.4184 [A.V. Babichev, S.D. Komarov, Y.S. Tkach, V.N. Nevedomskiy, S.A. Blokhin, N.V. Kryzhanovskaya, A.G. Gladyshev, L.Ya. Karachinsky, I.I. Novikov. Semiconductors, **57**, 93 (2023). DOI: 10.1134/S1063782623040012].
- [17] А.В. Бабичев, А.М. Надточий, С.А. Блохин, В.Н. Неведомский, Н.В. Крыжановская, М.А. Бобров, А.П. Васильев, Н.А. Малеев, Л.Я. Карачинский, И.И. Новиков, А.Ю. Егоров. ФТП, **58** (6), 318 (2024). DOI: 10.61011/FTP.2024.06.58946.6287
- [18] G. Bjork, Y. Yamamoto. IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., **27** (11), 2386 (1991). DOI: 10.1109/3.100877
- [19] B. Monemar, K.K. Shih, G.D. Pettit. J. Appl. Phys., **47** (6), 2604 (1976). DOI: 10.1063/1.322979
- [20] D.E. Aspnes, S.M. Kelso, R.A. Logan, R.J. Bhat. Appl. Phys., **60** (2), 754 (1986). DOI: 10.1063/1.337426
- [21] M. Sturge. Phys. Rev., **127** (3), 768 (1962). DOI: 10.1103/physrev.127.768
- [22] S. Adachi. *Physical properties of III-V semiconductor compounds* (John Wiley & Sons., Hoboken, NJ, U.S., 1992). DOI: 10.1002/352760281x
- [23] K. Gaur, S. Tripathi, F. Laudani, A. Barua, I. Limame, A. Koulas-Simos, S. Rodt, S. Reitzenstein. Laser Photonics Rev., **19** (18), e00533 (2025), DOI: 10.1002/lpor.202500533
- [24] N. Heermeier, T. Heuser, J. Große, N. Jung, A. Kaganskiy, M. Lindemann, N.C. Gerhardt, M.R. Hofmann, S. Reitzenstein. Laser Photonics Rev., **16** (4), 2100585 (2022). DOI: 10.1002/lpor.202100585
- [25] A. Babichev, I. Makhov, N. Kryzhanovskaya, S. Troshkov, Y. Zadiranov, Y. Salii, M. Kulagina, M. Bobrov, A. Vasil'ev, S. Blokhin, N. Maleev, L. Karachinsky, I. Novikov, A. Egorov. IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., **31** (2), 1502808 (2024). DOI: 10.1109/JSTQE.2024.3503724